



รายงานฉบับสมบูรณ์

เรื่อง

การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโพโตแคตالิสต์

Development of Nano-coating Materials, Photocatalyst Type

คณะผู้จัดทำ

รศ.ดร.เล็ก สีคง

รศ.กัลยาณี คุปตานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

การพัฒนาสารเคลือบชนิด ไทดอกไซด์ที่มีการโดยปี Saras 2 กลุ่มคือชนิด SiO_2 และ/หรือ SnO_2 และชนิด Ag และ/หรือ MWNTs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าติดกับสมบัติไฮโดรฟลิกผลิตด้วยวิธีโซล-เจล โดยสารเคลือบกลุ่มแรกเคลือบลงบนกระจากโซดาไลม์และกลุ่มที่สองเคลือบลงบนกระเบื้องเคลือบสีขาวด้วยวิธีการหมุนปั่น งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารโดยปี อุณหภูมิในการสังเคราะห์ฟิล์ม ความหนาของชั้นฟิล์มที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ การเกิดเฟส ประสิทธิภาพไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าติดกับสมบัติไฮโดรฟลิกของผงและพิล์มไทดอกไซด์และพิล์มผสมที่มีองค์ประกอบของไทดอกไซด์เป็นหลัก

สารโดยปีกลุ่มแรก จากผลการวิเคราะห์เฟสของผงไทดอกไซด์ พบเฟสอนาเทสจะเกิดขึ้นที่ $300 - 600^\circ\text{C}$ และที่อุณหภูมิ 700°C เกิดเฟสสมรรถะห่วงเฟสอนาคตและเฟสรูไกส์ เมื่อโดยปี SiO_2 หรือ SnO_2 มีผลทำให้ความเป็นผลึกของเฟสอนาคตลดลง และโครงสร้างอนาคตเสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 700°C จากการทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าติดกับของตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิ 500°C และเวลาในการรับรังสีญี่วี 6 ชั่วโมง พบว่าพิล์ม $\text{TiO}_2/3\text{SnO}_2$ พิล์ม $\text{TiO}_2/5\text{SiO}_2$ สามารถย้อมสีด้วยเมทิลีนบลู Methylene blue ได้ 98.13% และ 82.79% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับพิล์มไทดอกไซด์ที่ไม่มีสารโดยปีจะมีค่าเท่ากัน 78.05% และประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าของพิล์ม $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ เมื่อสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 600°C และได้รับรังสีญี่วี 6 ชั่วโมง เท่ากัน 82.51% ในขณะที่พิล์มไทดอกไซด์ที่ไม่มีสารโดยปีเท่ากัน 68.06% นุ่มนิ่มผัสของหยดน้ำบนผิวกระจากของ Uncoated, pure TiO_2 , $\text{TiO}_2/15\text{SiO}_2$, $\text{TiO}_2/3\text{SnO}_2$, $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ ที่เคลือบ 3 ชั้น และเวลาในการรับรังสีญี่วี 30 นาที มีค่าเท่ากัน $6, 13, 0, 0$ และ 7 องศา ตามลำดับ เมื่อเพิ่มจำนวนชั้นพิล์มจาก 1 ชั้นเป็น 2 ชั้น ประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าติดกับสมบัติไฮโดรฟลิกของพิล์มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดลงของนุ่มนิ่มผัสแต่ที่พิล์มเคลือบ 3 ชั้น นุ่มนิ่มผัสจะมากขึ้นเพราะมีรอยแตกของชั้นพิล์มเกิดขึ้น พบว่าการโดยปี SiO_2 มีผลต่อการเพิ่มสมบัติไฮโดรฟลิกในขณะที่การโดยปี SnO_2 มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าติดกับ 3 ชั้น ซึ่งทำให้สารเคลือบที่มี 3 องค์ประกอบของ $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ ที่ได้พัฒนาขึ้นมีสมบัติ

$TiO_2/SiO_2/SnO_2$ ที่ได้พัฒนาขึ้นมีสมบัติทั้งด้านไฟฟ้าและไฟฟ์ฟิกที่ดี จากผลการทดสอบการกัดกร่อนในภาวะกรดในตริกและด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเสื่อมขึ้น 5 % ของฟิล์มในกลุ่มนี้ พบว่าฟิล์มทุกชนิดจะทนต่อกรดได้ดีกว่าด่าง เพราะฟิล์มทุกชนิด ($TiO_2/TiO_2/5SiO_2$, $TiO_2/3SnO_2$, $TiO_2/SiO_2/SnO_2$, $TiO_2/SiO_2/3SnO_2$) มีสภาพเป็นกรดจึงทำปฏิกิริยา กับด่างดีกว่ากรด และพบว่าฟิล์มสามองค์ประกอบของ $TiO_2/SiO_2/SnO_2$ และ $TiO_2/SiO_2/3SnO_2$ จะ ทนกรดและด่างได้ดีที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้ปะ SiO_2 ทึบเนื้อไว้ ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้ปะ SiO_2 เท่ากันหรือมากกว่า 10% จะทนกรดและด่างดีกว่า SiO_2 อย่างไรก็ตามการกัดกร่อนยังขึ้นอยู่กับการติดแน่นของฟิล์มนวัสดุฐาน ด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้ปะ SiO_2 เท่ากันหรือมากกว่า 10% จะทนการกัด กร่อน โดยเฉพาะต่อสภาพด่างคีมาคเพราฟิล์มที่มีปริมาณ SiO_2 มากจะติดกับผิวกระจกได้แน่นขึ้น เช่นเดียวกันกับความหนาของฟิล์มที่เคลื่อน 1-2 ชั้นจะทำให้ติดแน่นและไม่มีรอยแตกขนาดเล็ก เมื่อ่อนฟิล์มหนา 3 ชั้น จึงมีการกัดกร่อนน้อยกว่าฟิล์ม 3 ชั้น

สารโดยปกติที่สอง อุณหภูมิในการเผาฟิล์มที่ 400 °C และ 500 °C ให้ผลประสิทธิภาพ ปฏิกิริยาไฟฟ้าและไฟติกสูงกว่าที่ 300 °C และ อุณหภูมิ 400-500 °C แสดงประสิทธิภาพ ปฏิกิริยาไฟฟ้าและไฟติกสูงสุดเนื่องจากการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิช่วงนี้ให้โครงสร้างอนาเทสที่ สมบูรณ์และมีขนาดผลลัพธ์เล็กที่สุด - สารโดยปั๊มนิค Ag มีผลต่อขนาดผลลัพธ์ของอนาเทสในการช่วย ขับยั้งการเติบโตของผลลัพธ์อนาเทส ทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภาคผงเพิ่มขึ้น และทำให้ฟิล์มเรียบ มากขึ้นเนื่องจากมีผลลัพธ์เล็กลงทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาไฟฟ้าและไฟติก และ สมบัติไฮดร็อฟิลิกเพรา Ag สามารถกักอิเล็กตรอนที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสง ไม่ให้กลับไป รวมตัวกับไฮโลเริ่วทำให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าและไฟติกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม MWNTs ถึงแม้ว่ามีผลต่อการทำให้ขนาดผลลัพธ์ของอนาเทสลดลงก็จริงแต่ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาไฟฟ้าและไฟติกของฟิล์มนิคนี้กลับไม่ดีกว่า pure TiO_2 น่าจะเป็นเพราะการกระจายตัวของ MWNTs ใน ฟิล์มไม่ค่อยสม่ำเสมอเพรา มีขนาดของห้องรับอนน้ำดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดผลลัพธ์ของ TiO_2 สารโดยปั๊มนิค Ag หรือ MWNTs มีผลต่อความยาวคลื่นแสงและแบบช่องว่างของพลังงาน กล่าวคือ เพิ่มความยาวคลื่นและลดแบบช่องว่างของพลังงานลง พบว่าประสิทธิภาพไฟฟ้าและไฟติกของ ฟิล์มเมื่อกระตุ้นด้วยแสงยูวีเรียงจากสูงไปต่ำได้ดังนี้ $1Ag/TiO_2 > 1Ag/1MWNTs/TiO_2 > pureTiO_2 \geq$

1MWNTs/TiO₂ แต่การกระตุ้นด้วยแสงฟลูออโรสเซนต์ ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเรียงจากสูงไปค่าดังนี้ 1Ag/TiO₂ > 1Ag/1MWNTs/TiO₂ > 1MWNTs/TiO₂ > pureTiO₂ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความยาวคลื่นและลดแบบช่องว่างของพัตตั้งงานลงนั่นเอง พิล์ม 1Ag/TiO₂, 1MWNTs/TiO₂ และ 1Ag/1MWNTs/TiO₂ สังเคราะห์ที่ 500 °C มีสมบัติในการทำความสะอาดด้วยน้ำได้เป็นอย่างดีเพรพยายามการกระตุ้นด้วยแสงญี่ปุ่น 5–10 นาทีจะมีสมบัติเป็นชูเปอร์ไฮโดรฟิลิกได้โดยเฉพาะพิล์มที่ได้ปั๊ดด้วย Ag และ MWNTs หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปริมาณ 1% อัตราการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคนต์ไฮดatic ของสารได้ปั๊ด Ag และ MWNTs หรืออย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเขียนเป็นสมการอักกิโนเคนนิลังนี้คือ $R = 1.00 e^{-kt}$ เมื่อ k ค่าคงที่ของจลนศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา และ t คือเวลาที่ฉายแสงหน่วยเป็นชั่วโมง

Abstract

The development of coating material of TiO₂ by doping some additives divided into 2 groups, group one were either SiO₂ or SnO₂ and both of them, and group two were either Ag or MWNTs and both of them to improve the photocatalytic efficiency and hydrophilic properties by sol-gel technique. For the first group, titanium dioxide and composite films were coated on soda-lime glasses whereas for the second group, they were coated on white-glazed ceramic tile substrates. This research is focused on not only the effect of the type and an amount of dopant but also that of the synthesized temperatures and film thickness on morphology, phase transformation, photocatalytic reaction and hydrophilic property of TiO₂ and composite films.

First Group of Dopants: For TiO₂ powder, it was found that anatase phase appears at the temperature range of 300 – 600 °C and mixed phases of anatase and rutile exist together at 700 °C. The addition of either SiO₂ or SnO₂ results in a decrease in the crystallinity of anatase phase at the temperature over than 700 °C. In addition, the photocatalytic activities of the films calcined at temperature of 500 °C were performed by means of the degradation of methylene blue solution while contact angles of water droplet on film surfaces which are responsible for hydrophilic property were measured under UV irradiation at various times. It was

found that $\text{TiO}_2/3\text{SnO}_2$ and $\text{TiO}_2/5\text{SiO}_2$ films could degrade methylene blue by 98.13 % and 82.79 % respectively, whereas that of pure TiO_2 was 78.05 %. Furthermore, the efficiency of photocatalytic reaction of $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ film calcined at the temperature of 600 °C was 82.51 %, while that of pure TiO_2 was only 68.06 %. The contact angle of water droplet on the uncoated and three layers coated films of TiO_2 , $\text{TiO}_2/15\text{SiO}_2$, $\text{TiO}_2/3\text{SnO}_2$ and $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ for the irradiation time 30 minutes were 6, 13, 0, 0 and 7 degrees respectively. When number of coating layers was increased from 1 to 2 layers, the photocatalytic efficiency and hydrophilic property of the films increased due to a decrease in contact angle. In contrast, the three layers of film thickness caused to raise contact angle because of the micro cracks on the film surface. In this finding, the addition of SiO_2 can improve hydrophilic property, whereas that of SnO_2 can improve the photocatalytic efficiency. Therefore, coating material of $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ can provide the better property in both photocatalytic and hydrophilic properties. Corrosion test of films was performed by soaking the coated specimens in nitric acid and sodium hydroxide solution with the concentration of 5 % for 48 hours. It was found that all kinds of films can resist to nitric acid than sodium hydroxide because these films are naturally acidic films, they therefore reacted better with basic solution than acidic solution. It was also found that the three components composite films of $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{SnO}_2$ and $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/3\text{SnO}_2$ exhibit a high resistance to both nitric acid and sodium hydroxide solutions. Furthermore, SnO_2 -doped TiO_2 film resist to acid and base more than SiO_2 -doped TiO_2 film because SnO_2 itself has higher resistance to acid and base than SiO_2 .